| 산업통상자원부 http://www.motie.go.kr | 보 도 자 료 | 정부혁신 보다나은 정부 |
|---|---|---|

**2020년 1월 16일(목) 조간부터** 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 1. 15.(수) 오전 11시 이후 보도 가능)

| 배포일시 | 2020. 1. 15.(수) | 담당부서 | 반도체디스플레이과 |
|---|---|---|---|
| 담당과장 | 강감찬 과장(044-203-4270) | 담 당 자 | 주미나 사무관(044-203-4273) |

# 동진쎄미켐, 1분기 포토레지스트 증설공장 착공으로 공급안정성 강화 기대

## - 정승일 산업부 차관, 동진쎄미켐 방문, 소부장 정책의지 밝혀 -

□ 정승일 산업통상자원부 차관은 1월 15일(수) 오후 경기도 화성시 소재의 **반도체·디스플레이용 소재**기업인 **동진쎄미켐**을 방문하였다.

**【 현장방문 개요 】**

- **일시/장소 :** '20.1.15(수) 15:00~16:00 / 동진쎄미켐 화성공장
- **참석자 :** (산업부) 차관, 반도체디스플레이과장 등
  (동진쎄미켐) 이준혁 대표이사 등 임직원
- **내용 :** 포토레지스트 국내생산 현장상황 공유
  소부장 정책 성과 제고를 위한 기업 현장애로 의견수렴 등

○ 이번 정 차관의 방문은 **새해 첫 현장 방문**으로,

- 반도체 핵심소재 중 하나인 **포토레지스트*의 국내 생산 기업 임직원들을 직접 격려**하고, **현장 목소리**를 청취하기 위해 이뤄졌다.

* 반도체·디스플레이 제조과정에서 기판 위에 전자회로 패턴형성을 위해 사용되는 감광재

□ 이번 방문대상 기업인 **동진쎄미켐**은 극자외선용 포토레지스트의 바로 전 단계인 반도체용 **불화아르곤 액침(ArF-immersion) 포토레지스트**를 국내 최초('10년)로 **개발·생산**한 **반도체·디스플레이용 소재 전문기업**으로,

○ 올해 1분기 중에 **불화크립톤(KrF), 불화아르곤(ArF)** 등 **포토레지스트 생산공장 증설을 착공**(설계는 이미 완료)할 예정이다.

○ 증설공장이 계획대로 완공 후 **내년 초 정상가동**되면 동진쎄미켐은 **국내 포토레지스트 생산량을 현재보다 2배 이상 확대 생산**하게 된다.

□ **포토레지스트는 감광재**로써 반도체의 노광(Photo) 공정 단계에서 **웨이퍼 기판에 패턴을 형성하기 위해 필수적으로 사용**되는데,

○ 반응하는 빛의 파장에 따라 주로 **불화크립톤(KrF, 248nm), 불화아르곤(ArF, 193nm), 극자외선(EUV, 13.5nm)용 등으로 구분**되며, 반응하는 빛의 **파장이 짧을수록 공정 미세화가 가능**하다.

○ **포토레지스트는 그간 일본으로부터의 수입에 의존**하여 왔으나, 일본의 수출규제 이후, **대일(對日) 수입 의존도를 낮춰 공급안정성을 빠르게 확보**해 나가고 있다.

* 포토레지스트 대일 수입비중(무역협회) : ('19.1~6월 누적) 92% → ('19.7~11월 누적) 85%

○ 우선, ①**벨기에(RMQC), 미국(듀폰), 독일(머크) 등 일본 외 국가로 수입국을 다변화하고 있고,**

* '19.7~11월(누적) 포토레지스트 수입액의 전년동기 대비 증가율(무역협회)
: (벨기에) 1,031.4%, (미국) 15.8%, (독일) 66.7%

②**듀폰으로부터 극자외선용 포토레지스트 개발·생산시설 등 구축**을 위한 **한국 투자**(2.8천만불, '20~'21)를 **확정**('20.1.9) 받아 국내 주요 수요 업체와 **제품 실증테스트를 진행**해 나갈 계획이며,

③**국내 기술개발, 양산평가** 등을 통해 **포토레지스트의 국내 기술력을 확보**해 나갈 예정이다.

* 불화아르곤 액침 고도화 기술 개발 등 포토레지스트 연구개발 총 230억원('19~'21) 지원

□ 정 차관은 "작년 7월 일본 수출규제 이후 **민관이 힘을 합쳐 노력**해 온 결과, 포토레지스트를 포함하여 **3대 품목 등 핵심소재의 공급안정성이 확보**되어 가고 있다"면서

○ “올해 **1분기 내 동진쎄미켐의 생산공장 증설 착공 등**으로 **포토레지스트의 국내 공급 안정성이 한층 더 강화**될 것으로 기대한다”고 하며, “**흔들림 없이 기술개발에 매진**해 온 **임직원에게도 감사**”를 표했다.

○ 이준혁 대표도 “생산공장 **증설이 신속하게 착수**될 수 있었던 것은 정부의 **대규모 연구개발 투자, 공장증설용 토지**에 대한 **신속한 용도변경*** 등 **범정부적 지원이 있었기** 때문에 가능했다”라면서 화답했다.

* 경기도 산단용지 변경결정('19.9월) 및 고시('19.11월)

□ 정 차관은 **첨단 포토레지스트 기술개발에 있어서도 지원을 아끼지 않을 계획**임을 언급하며, “올해를 **미래 10년을 만들어가는 소부장 산업 경쟁력 확보의 원년**으로 삼고, 대외여건 변화와 관계없이 **소부장 경쟁력 강화 정책을 지속적이고 일관적으로 추진**해 나가겠다”고 밝혔다.

**※ 현장사진은 별도 배포 예정**

【붙 임】 산업부 차관 동진쎄미켐 현장방문 세부 일정

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 반도체디스플레이과 주미나 사무관(☎ 044-203-4273)에게 연락주시기 바랍니다.

**붙임** **산업부 차관 동진쎄미켐 현장방문 세부일정**

## □ 목적

○ 반도체 공정에 필수적으로 사용되는 **포토레지스트의 국내생산 현황 점검** 및 **현장 근로자 격려**

## □ 방문개요

○ **(일시/장소)** ’20.1.15(수) 15:00~16:00, 동진쎄미켐 공장(경기 화성시)

* 제품: 반도체·디스플레이용 감광액, 박리액, 세척액, 식각액 등

○ **(참석)** 정승일 산업부 차관, 반도체디스플레이과장,
동진쎄미켐 이준혁 대표이사 등 임원진

○ **(세부 일정)**

| 시간 | 주요 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 15:00 ~ 15:03 (03’) | • 인사 말씀 | 차관 |
| 15:03 ~ 15:18 (15’) | • 회사 소개 (동영상 등) | |
| 15:18 ~ 15:38 (20’) | • 일본 수출규제 영향, 건의사항 등 | 참석자 |
| 15:38 ~ 15:40 (02’) | • 이동 (3층 간담회실 → 1층 클린룸) | |
| 15:40 ~ 15:55 (15’) | • 1층 클린룸 투어 | |
| 15:55~16:00 (05’) | • 기념 촬영 | |